

成都真空设备厂家 research热蒸发/磁控溅射 多靶复合磁控溅射镀膜机 离子刻蚀机功能 可定制

产品名称	成都真空设备厂家 research热蒸发/磁控溅射 多靶复合磁控溅射镀膜机 离子刻蚀机功能 可定制
公司名称	成都汉普升科技有限公司
价格	1000000.00/套
规格参数	
公司地址	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城西二路288号派瑞国际4栋5楼
联系电话	13683458179

产品详情

主要功能：多靶复合磁控溅射镀膜机，可满足合金膜、单层膜、多层膜、导电膜、非导电膜和反应溅射的需要，具有极高的实用性和通用性（三靶、垂直与共溅射合一、在线清洗基片等），能够提供高水平功能薄膜研制，特别适合于半导体、新能源、磁性材料、储氢材料、二维材料、超硬薄膜、固体润滑薄膜、自洁净薄膜、等领域前沿研究，同时可选配等离子刻蚀功能和辅助镀膜。

1. 主体和腔室：全封闭框架结构，机柜和主机为一体式结构，骨架默认为白色，门板为白色，四只脚轮，可固定，可移动。真空腔室采用优质0Cr18Ni9不锈钢材质（SUS304），腔体尺寸不小于为：450x500mm；真空室为前开门方式，采用铰链连接，自动锁紧，并配有门到位开关，彻底杜绝误操作；真空腔室设置DN100观察窗口，位置在真空腔体正前方。

2. 真空系统：

2.1 极限真空度 Pa（空载、经充分烘烤除气并充干燥氮气）。

2.2 真空配置。前级泵为机械真空泵，抽速优于8L/S，超高分子泵一台，抽速1200L/S。

2.3 真空测量：采用进口全量程真空计，优选德国莱宝与瑞士inficon。

3. 工件盘系统：配备工件盘一套，可安装4英寸基片1片，选配高温工件盘 < 800 。

4. 磁控溅射系统：配置三只2-4英寸溅射阴极，三只靶均能兼容直流和射频溅射，并可单独自由切换，磁控靶安装与真空室底部，向上溅射成膜。

5. 充气系统：二路分别配置MFC质量流量控制器，均为0-100SCCM，准确度 $\pm 1\%F.S$ ，线性 $\pm 0.5\%F.S$ ，重复精度 $\pm 0.2\%F.S$ 。

5. 其他：配置断水保护，配置冷水机组，冷水机制冷量为5000Kcal；设备配备小型静音空压机；保修期1年，维修响应时间不超过24小时。

6. 操作系统及安全监控：采用人机界面+西门子PLC实现对设备集中自动控制；所有控制系统和电气安装均与主机集成在一起，避免控制柜与主机之间线路放在地上或从顶部引入带来的问题，模块化设计能确保shebao维护维修的便捷性。